【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2003-55406(P2003-55406A)
【公開日】平成15年2月26日(2003.2.26)
【出願番号】特願2002-129805(P2002-129805)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０８Ｆ　8/04
【ＦＩ】
　Ｃ０８Ｆ　8/04

【手続補正書】
【提出日】平成16年12月8日(2004.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１，２－ブタジエン反復単位（Ａ）と１，４－ブタジエン反復単位（Ｂ）を含むブタジエンポリマーを水素と水素化触媒としてチタン、ジルコニウム及び／又はハフニウム系メタロセン化合物と助触媒の存在下に水素化し、反復単位の総モル／モル濃度を１００％として計算した場合に１，２－ブタジエン反復単位（Ａ）３モル％以下とエチレン反復単位（Ｄ）３モル％以下を含む部分水素化ブタジエンポリマーを製造する方法であって、
ａ）水素化触媒の反応速度比ｒ１／ｒ２（式中、ｒ１とｒ２は同一反応条件下の夫々反復単位（Ａ）及び（Ｂ）の水素化速度である）が５よりも大きく、
ｂ）助触媒がアルカリ金属水素化物であり、そのまま加えるか又はｉｎ　ｓｉｔｕ製造し、
ｃ）反復単位（Ａ）の少なくとも９７％が水素化されるまで共役ジエンの水素化を行うことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法により製造した製品。